

Patent- und Gebrauchsmusterrecht in Japan

NEU

Harald Baum / Moritz Bälz (Hrsg.)
Zeitschrift für Japanisches Recht
Sonderheft 2009

Patent- und Gebrauchsmusterrecht in Japan

2009, 128 Seiten,

€ 45,-

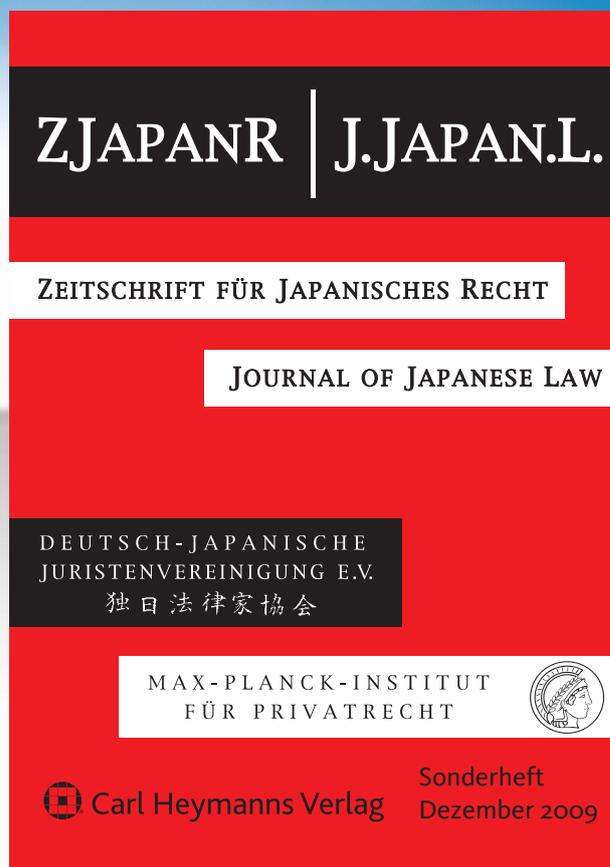
ISBN 978-3-452-27291-1

Erschienen im Dezember 2009

Dieses Sonderheft der **Zeitschrift für Japanisches Recht** (ZJapanR) stellt das Patent- und Gebrauchsmusterrecht in Japan aus der Sicht erfahrener Praktiker vor.

Die Autoren sind *Guntram Rahn, Dirk Schüssler-Langeheine, Marc Dernauer, Anja Petersen-Padberg, Clemens Tobias Steins und Alexander Dehner.*

Sie geben einen Überblick über die historische Entwicklung des Patent- und Gebrauchsmusterrechts, behandeln Erfindungen i.S.d. Patentrechts, das Recht an der Erfindung, die Erteilung, den Widerruf und die Berichtigung sowie die Wirkung von Patenten, erläutern den Patentverletzungsprozess und das Arbeitnehmererfinderrecht und beleuchten den Gebrauchsmusterschutz.



SHOP  www.wolterskluwer.de
einfach online kaufen...

Zu beziehen über Ihre Buchhandlung oder direkt beim Verlag.

 **Carl Heymanns Verlag**
eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Luxemburger Str. 449 • 50939 Köln
www.wolterskluwer.de • E-Mail info@wolterskluwer.de